平成 30 年　基礎・材料・共通部門大会セッションプログラム

セッション名の後の（　）内は件数です

<table>
<tr><th rowspan="2">日時
会場</th><th colspan="5">9 月 4 日（火）</th><th colspan="3">9 月 5 日（水）</th></tr>
<tr><th colspan="2">午前</th><th colspan="3">午後</th><th colspan="2">午前</th><th>午後</th></tr>
<tr><td>A 会場

あいめっせ
ホール</td><td>4-A-a1
9:15 ～ 10:30
プラズマ・放電・パル
スパワー
放電・基礎現象Ⅰ
(5)</td><td>4-A-a2
10:45 ～ 12:00
プラズマ・放電・パル
スパワー
放電・基礎現象Ⅱ
(5)</td><td rowspan="6">4-P
13:15 ～ 15:15
ポスター発表
P 会場：
第 3，4 展示室

コアタイム
ポスター番号
奇数：13:15 ～ 14:15
偶数：14:15 ～ 15:15</td><td>4-A-p2
15:30 ～ 16:45
プラズマ・放電・パル
スパワー
放電・基礎現象Ⅲ
(5)</td><td rowspan="6">表彰式
17:10 ～ 17:25
あいめっせホール

特別講演
17:30 ～ 18:40
あいめっせホール

懇親会
19:15 ～ 21:15
灘菊酒造</td><td>5-A-a1
9:15 ～ 11:00
プラズマ・放電・パル
スパワー
放電・基礎現象Ⅳ
(7)</td><td>5-A-a2
11:15 ～ 12:30
プラズマ・放電・パル
スパワー
放電・基礎現象Ⅴ
(5)</td><td>5-A-p1
13:30 ～ 15:30
プラズマ・放電・パル
スパワー
放電・基礎現象Ⅵ
(8)</td></tr>
<tr><td>B 会場

セミナー室
A</td><td></td><td>4-B-a2
10:15 ～ 11:30
誘電・絶縁材料Ⅰ
(5)</td><td>4-B-p2
15:30 ～ 17:00
誘電・絶縁材料
計測Ⅰ
(6)</td><td>5-B-a1
9:15 ～ 10:45
誘電・絶縁材料
計測Ⅱ
(6)</td><td>5-B-a2
11:00 ～ 12:15
誘電・絶縁材料Ⅱ
(5)</td><td>5-B-p1
13:30 ～ 15:00
誘電・絶縁材料Ⅲ
(6)</td></tr>
<tr><td>C 会場

セミナー室
B</td><td></td><td>4-C-a2
10:15 ～ 11:30
電磁環境
(5)</td><td>4-C-p2
15:30 ～ 16:15
光応用・視覚
電磁界理論
電気技術史
(3)</td><td>5-C-a1
9:15 ～ 10:30
教育・研究
(5)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D 会場

セミナー室
C ＋ D</td><td></td><td>4-D-a2
10:15 ～ 12:00
半導体・機能・
超電導材料
(7)</td><td>4-D-p2
15:30 ～ 16:45
計測
(5)</td><td>5-D-a1
9:15 ～ 11:00
プラズマ・放電・パル
スパワー
放電応用
(7)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>E 会場

第 1 ＋ 2
会議室</td><td colspan="2">4-E-a1
9:15 ～ 12:10
＜テーマ付セッション＞
高性能永久磁石における研究開発最前線
(2+ ⑥)</td><td>4-E-p2
15:30 ～ 16:45
磁性材料・磁気応用・
マイクロ磁気Ⅰ
(5)</td><td>5-E-a1
9:15 ～ 10:30
磁性材料・磁気応用・
マイクロ磁気Ⅱ
(5)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>F 会場

アート
ホール</td><td></td><td>4-F-a2
10:15 ～ 12:10
プラズマ・放電・パル
スパワー
パルスパワー
(6+ ①)</td><td></td><td>5-F-a1
9:15 ～ 10:55
プラズマ・放電・パル
スパワー
プラズマⅠ
(5+ ①)</td><td>5-F-a2
11:10 ～ 12:40
プラズマ・放電・パル
スパワー
プラズマⅡ
(6)</td><td></td></tr>
</table>

※ 1　プラズマ・放電・パルスパワーは合同セッション
※ 2　丸数字は企業招待講演の件数